

主要半導体材料ガス等国内市場実績5年推移

(暦年:2004年~2008年)

有限責任中間法人 日本産業・医療ガス協会  
特殊ガス分科会

単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2004年 (平成16年)		2005年 (平成17年)		2006年 (平成18年)		2007年 (平成19年)		2008年 (平成20年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルシン	AsH3	22,800	112%	22,500	99	20,300	90%	20,200	100%	21,400	106%
2	ジボラン	B2H6	550	108%	610	111	630	103%	630	100%	590	94%
3	三塩化ホウ素	BCl3	84,000	112%	92,000	110	92,000	100%	92,000	100%	98,000	107%
		*1	35,000	117%	35,000	100	35,000	100%				
4	四フッ化炭素	CF4	443,000	116%	428,000	97	477,000	111%	494,000	104%	489,000	99%
5	三フッ化メタン	CHF3	54,400	107%	51,500	95	67,600	131%	73,800	109%	85,200	115%
6	六フッ化エタン	C2F6	537,000	109%	507,000	94	453,000	89%	390,000	86%	343,300	88%
7	八フッ化プロパン	C3F8	43,000	119%	52,000	121	62,000	119%	92,000	148%	116,000	126%
8	八フッ化シクロブタン	C4F8	20,000	117%	23,000	115	25,000	109%	27,000	108%	29,000	107%
9	塩素	Cl2	95,000	120%	105,000	111	165,000	157%	185,000	112%	203,000	110%
10	ゲルマン	GeH4	100	100%	100	100	100	100%	110	110%	120	109%
11	臭化水素	HBr	42,000	131%	50,000	119	61,000	122%	72,200	118%	83,000	115%
12	塩化水素	HCl	200,000	100%	220,000	110	240,000	109%		0%		
13	アンモニア	NH3	760,000	138%	873,000	115	1,033,000	118%	1,132,000	110%	1,168,000	103%
14	三フッ化窒素	NF3	600,000	132%	632,000	105	885,000	140%	1,168,000	132%	1,423,000	122%
15	一酸化二窒素	N2O	260,000	108%	375,000	144	545,000	145%	610,000	112%	580,000	95%
16	ホスフィン	PH3	14,500	124%	16,100	111	18,100	112%	18,400	102%	17,700	96%
17	モノシラン	SiH4	267,000	113%	289,000	108	319,000	110%	349,000	109%	407,000	117%
18	ジシラン	Si2H6	500	100%	500	100	500	100%	500	100%	500	100%
19	ジクロロシラン	SiH2Cl2	130,000	113%	120,000	92	125,500	105%	144,000	115%	155,000	108%
20	四塩化ケイ素	SiCl4	3,000	60%	10,000	333	15,000	150%	16,000	107%	18,000	113%
		*3	2,880,000	105%	3,240,000	113	3,900,000	120%				
21	四フッ化ケイ素	SiF4	6,000	100%	6,000	100	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%
22	TEOS	(C2H5O)4Si	103,000	124%	142,000	138	205,000	144%	342,000	167%	378,000	111%
23	六フッ化硫黄	SF6	160,000	104%	160,000	100	192,000	120%	197,000	103%	207,000	105%
24	六フッ化タングステン	WF6	45,000	107%	55,000	122	68,000	124%	78,000	115%	86,000	110%
25	有機金属		1,450	132%	1,500	103	1,500	100%	1,500	100%	1,750	117%
26	その他	HCl H2Se BF3 SiHCl3等				100%		109%				
年間需要金額(単位:億円)			435	107%	430.8	99%	476	110%	515	108%	552	117%

(注) \*1: PBN用 2007年より統計対象外  
\*2: HCl 2007年より統計対象外  
\*3: 光ファイバー用 2007年より統計対象外